

2018(平成30)年度 第2回 光材料・応用技術研究会

日時：2018年 8月31日(金) 13:00~17:00

会場：株式会社日本レーザー 本社 3階大会議室

テーマ：レーザーの高出力化と新たな材料処理
～拡大する VCSEL 応用から材料の高付加価値処理技術まで～

担当幹事：小野円佳(旭硝子),山本和久(大阪大学),平等拓範(分子科学研究所)

***** プログラム *****

13:00-13:10 代表幹事挨拶

皆方 誠(静岡大学)

(講演)

1. 13:10-13:50 産業用レーザーの高出力化(CLEO 情報含む)

平等 拓範(分子科学研究所)

***** 休憩(5分) *****

2. 13:55-14:35 VCSEL とその応用 光通信からレーザー給電まで

宮本 智之(東京工業大学)

***** コーヒーブレイク(14:35~14:50) *****

3. 14:50-15:30 産業応用向け高出力 VCSEL モジュールの開発

泉谷 一磨(リコー)

***** 休憩(5分) *****

4. 15:35-16:15 近接場光エッチングによるサブナノ平滑化の進展

八井 崇(東京大学)

***** 休憩(5分) *****

5. 16:20-16:55 ステルスダイシング ～内部吸収型レーザーダイシング技術とその応用～

河口 大祐(浜松ホトニクス)

16:55-17:00 研究会からのお知らせ(事務局)

17:15-18:45 名刺交換会(同会場にて、参加無料)

参加人数には限りがございますので定員となり次第締め切らせていただきます。先着順の受付となりますので、お早めにお申し込みください。尚、参加希望者が多数見込まれますので、会員同伴の参加者は1名様までとさせていただきます。御了承お願い致します。

[お問合せ先] 本研究会に関するお問合せは、光協会(担当:開発部 間瀬)へ御連絡願います。

E-mail: omat@oitda.or.jp、TEL: 03-5225-6431(代)

[会場案内] 株式会社日本レーザー 本社

住所:東京都新宿区西早稲田2-14-1 TOHMA早稲田ビル3F

(御参考)日本レーザーHP;<http://www.japanlaser.co.jp/>

交通:

・東京メトロ副都心線「西早稲田駅」下車、2番出口より徒歩約5分。

・JR山手線、東京メトロ地下鉄東西線、西武新宿線の「高田馬場駅」下車の場合、タクシーを御利用下さい。

事務局：一般財団法人光産業技術振興協会 開発部 間瀬、山田 TEL (03)5225-6431 FAX (03)5225-6435

2018年度第2回 光材料・応用技術研究会 **【研究会会場アクセスMAP】**

研究会

- ・日時 : 2018年8月31日(金) 13:00~17:00
- ・会場 : (株)日本レーザー 本社
東京都新宿区西早稲田2-14-1 TOHMA早稲田ビル3F
- ・アクセス : 東京メトロ副都心線「西早稲田駅」下車、2番出口より徒歩約5分

名刺交換会

- ・時間 : 17:15~18:45
- ・会場 : 日本レーザー本社 (研究会会場と同じ)

